

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年4月13日(2006.4.13)

【公開番号】特開2004-264773(P2004-264773A)

【公開日】平成16年9月24日(2004.9.24)

【年通号数】公開・登録公報2004-037

【出願番号】特願2003-57401(P2003-57401)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/038 (2006.01)

C 0 8 G 59/14 (2006.01)

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

G 0 3 F 7/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/038 5 0 1

C 0 8 G 59/14

G 0 3 F 7/004 5 0 1

G 0 3 F 7/027 5 1 5

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月27日(2006.2.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

このようなフォトレジストインクは、基板密着性、耐薬品性、電気特性、耐金めっき性、はんだ耐熱性、耐電蝕性等の特性を満足させる必要があり、このような特性を有する、フォトレジストインクに適用できる感光性樹脂組成物として、従来、エポキシ基を有するエチレン性不飽和化合物と、1分子中にエチレン性不飽和基を2個以上有する化合物とを含有するエチレン性不飽和化合物成分を重合させて生成される共重合体に、カルボキシル基を有するエチレン性不飽和単量体を反応させた後、飽和又は不飽和の多塩基酸無水物を反応させて生成される感光性樹脂をベース樹脂とし、これにエポキシ化合物等の熱硬化性成分、光重合開始剤、希釈剤等を配合したものが提供されている（特許文献1参照）。